

Porta Wafer Circolare In Ptfе Da 6 Pollici, Cestello Per Pulizia Semiconduttori Resistente Agli Acidi E Agli Alkali, Personalizzabile

Numero articolo: PL-CP55



introduzione

Porta wafer in PTFE ad alta purezza da 6 pollici progettati per la lavorazione umida critica di semiconduttori. Progettati per un'estrema resistenza chimica e stabilità termica, questi cestelli a fioriera personalizzabili garantiscono una pulizia uniforme e la protezione dei substrati in ambienti di immersione acida e alcalina aggressivi durante tutta la produzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Applicazione	Descrizione	Vantaggio chiave
Pulizia RCA per semiconduttori	Immersione dei wafer in soluzioni SC-1 e SC-2 per rimuovere contaminanti organici e ionici.	Resistenza totale agli agenti ossidanti e alle basi ad alta temperatura.
Processi di incisione umida	Rimozione selettiva di strati di materiale con acido fluoridrico (HF) o fosforico.	Il posizionamento preciso del substrato garantisce una profondità di incisione uniforme su tutto il wafer.
Stripping della fotolitografia	Rimozione di strati di fotoresist con solventi organici aggressivi o soluzioni Piranha.	Il materiale non si gonfia né si degrada se esposto a solventi aggressivi.
Texturizzazione di celle solari	Pulizia ad alto volume e texturizzazione della superficie di wafer di silicio per una migliore efficienza.	Il design resistente sopporta lo stress della produttività chimica su scala industriale.
Risciacquo post-CMP	Rimozione di particelle di impasto e prodotti chimici dopo la lucidatura meccanico-chimica.	Le superfici ultra lisce impediscono il riattaccaggio delle particelle e facilitano il risciacquo.
Preparazione per analisi di tracce	Pulizia di componenti di laboratorio ad alta purezza in acido nitrico o cloridrico concentrato.	Elimina i rischi di contaminazione incrociata per l'analisi elementare ultra-tracce.
Fabbricazione MEMS	Gestione specializzata dei substrati per la produzione di sistemi microelettronici.	Le dimensioni delle fessure personalizzabili accolgono spessori di substrato non standard.

Parametro	Specifica per PL-CP55
Identificazione prodotto	Portawafers circolare PL-CP55 (Fioriera)
Composizione materiale	Politetrafluoroetilene (PTFE) vergine ad alta purezza
Compatibilità dimensione wafer	Standard 6 pollici (150mm) (Dimensioni personalizzate disponibili)
Configurazione	Cestello circolare fessurato / Design a fioriera perforata
Numero di fessure / Capacità	Personalizzabile (Opzioni standard: 10, 25 o 50 fessure)
Temperatura di esercizio	-200°C a +260°C (-328°F a +500°F)
Resistenza chimica	pH 0-14 (Resistenza universale ad acidi, alcali e solventi)
Larghezza fessura / Passo	Completamente personalizzabile secondo le specifiche dell'utente

Applicazione	Descrizione	Vantaggio chiave
Parametro	Specifica per PL-CP55	
Tipo di maniglia	Maniglia fissa integrata o maniglia basculante in PTFE rimovibile (Personalizzabile)	
Finitura superficiale	Liscia lavorata CNC ($Ra \leq 0,8\mu m$ tipico)	
Metodo di fabbricazione	Lavorazione CNC di precisione al 100% (Prodotto personalizzato)	
Dimensioni	Progettato su misura per adattarsi a specifiche dimensioni di banchi di lavorazione o serbatoi	